創立80周年記念特集「材料科学の変遷と展望~社会からの要求に応えて~」

# 透過電子顕微鏡法の最新技術動向と 将来展望(超高分解能イメージング)

雄

原

幾

.\*

## 1. はじめに

今世紀に入って透過電子顕微鏡法の分解能は、球面収差補 正装置の出現とあいまって飛躍的な向上をとげている. 現時 点での走査透過電子顕微鏡法(Scanning Transmission Electron Microscopy, STEM)の分解能は 45 pm<sup>(1)</sup>, 高分解能電 子顕微鏡法(High Resolution Transmission Electron Microscopy, HRTEM)の分解能は44 pm<sup>(2)</sup>に達しており、いずれ も日本が世界記録を有している(2016年12月時点). 従来は 電子顕微鏡の分解能といえば HRTEM が主体で,1996年に 独の MPI が超高圧電子顕微鏡によって1Å の分解能を達成 して以降,この値が長らく電子顕微鏡の最高分解能とされて きた. それまでの歴史的な変遷については既に多くの文献で 報告されているので<sup>(3)-(6)</sup>,本報では、主に、今世紀に入っ てから普及したレンズ収差補正技術による分解能向上の変遷 とそれに伴う技術革新,材料研究への応用ついて紹介する. さらに最近急速に進展しつつある、低加速電圧電子顕微鏡法 や微分位相コントラスト法の展開についても言及する.

#### 2. 収差補正電子顕微鏡の出現と分解能

1990年代に実現した収差補正装置の開発は電子顕微鏡分 野を大きく変革させた.しかし,そのアイデアはScherzer によって既に1947年に提案されていた<sup>(7)</sup>.Scherzer は多極 子レンズを組み合わせることで球面収差が補正できることを 提案している.図1(a)に4極子と8極子レンズの模式図を 示す.図中,N極とS極が形成する磁場とそれにより電子 線が偏向(発散と収束)する方向(太い矢印)を示してある.こ の二つの多極子レンズを上手く組み合わせることによって,

電子線を偏向しては元に戻すという複雑な過程を繰り返しな がら球面収差を補正することが可能となる<sup>(8)</sup>.このように回 転対称な電子レンズでは不可能な収差補正を回転非対称なレ ンズを組み合わせることによって可能になることが提案さ れ,過去にも、4極子レンズ、8極子レンズ、6極子レンズ、 12極子レンズなどの回転非対称なレンズの試作や検証が行 われてきたが、なかなかその実現には至らなかった、これ は、レンズ設計の精度、加工技術、電気的安定度、など種々 の複合的な問題に起因していたようである(5). その開発の過 程で、Hawkesは6極子が負の球面収差を生み出すことを初 めて指摘し<sup>(9)</sup>, その後, Beck<sup>(10)</sup>とCrewe ら<sup>(11)</sup>が6極子を 用いた球面収差補正を提唱したが、実用化には至らなかっ た. しかし, 1990年に Rose は, 2 段の6 極子レンズと転送 レンズを組み合わせるという独自のアイデアにより最初に TEM 用の収差補正装置を考案し<sup>(12)</sup>,これを基に,1995年 に CEOS 社の Heider らが実用可能な球面収差補正装置を初 めて開発した<sup>(13)</sup>.図1(b)にHeider らによって開発された Rose型6極子球面収差補正装置の模式図を示すが、現在各 社より市販されている収差補正装置のほとんどがこの方式と なっている.一方,4極子-8極子収差補正装置<sup>(8)</sup>は,1999 年に Nion 社の Krivanek らにより STEM 用として開発され た<sup>(14)</sup>. これら一連の収差補正装置の原理および概要につい ては沢田ら(15)および阿部(16)による優れた解説に詳しく記載 されているのでそちらを参照されたい.また,我国において は、2008年に、日本電子株式会社の Hosokawa, Sawada ら が、二つの六極子場(12極子)レンズの厚さが異なり、転送 レンズの焦点距離も異なる独自の収差補正装置を開発し, 300 kVのTEMに搭載することに初めて成功してい Z<sup>(17)</sup>(18).

上述したように, Haider らは, 1995年の論文で, グラフ

\* 東京大学大学院工学系研究科総合研究機構;教授, 励ファインセラミックスセンターナノ構造研究所;主管研究員(〒113-8656 東京都 文京区弥生2-11-16)

Recent Technical Trend and Future of Transmission Electron Microscopy (Atomic Resolution Imaging); Yuichi Ikuhara(Institute of Engineering Innovation, The University of Tokyo, Tokyo, Japan Fine Ceramics Center, Nagoya) Keywords: *STEM, spherical aberration correctors, atomic resolution, annular bright field, light element visualization, interface characterization* 2016年8月5日受理[doi:10.2320/materia.56.254]

だけではあるが、Cs=0を実証しており<sup>(13)</sup>、収差補正の実 現という意味では、1995年が起点となっていると言える. 一方、STEM への応用を考えると、1999年の Krivanek ら の報告が最初と考えられ<sup>(14)</sup>、実際の STEM 像で分解能の向 上を示した<sup>(19)</sup>.近年の STEM の優位性、STEM コレクタ ーと分析電子顕微鏡法の組み合わせによる発展を考慮すると、 STEM への収差補正の導入が、STEM のその後の革新的な 普及につながっていったものと思われる.

収差補正装置の発展に伴い,分解能が大幅に向上したが, 図2に2000年以降の分解能向上のグラフを示す.2002年に Krivanekのグループが,収差補正装置をSTEMに導入する ことにより1Å(0.1 nm)以下のプローブが形成できる可能性 を示し,STEMが今後材料解析に極めて有用であることを 示した<sup>(19)</sup>.しかし,この論文で示されたSTEM像は



図1 収差補正装置の概要.(a)4極子および8極子レ ンズによる磁場と電子線の偏向,(b)2段の6極 子レンズと転送レンズを組み合わせた収差補正装 置.



図2 収差補正装置導入後の分解能の向上(2000年以降) \*はFFT データによる.

Ge<sub>30</sub>Si<sub>70</sub>[110]の136 pm を分解する像であった. 実際に1 Å(0.1 nm)以下の分解能を最初に達成したのは,2004年の Pennycook らが示した Si [112]の78 pm であると推定され るが、これはNion社の収差補正措置を用いた300kVの STEM 機(VGHB603U)で達成したものである<sup>(20)</sup>. その後 2007年に、日本の JST のプロジェクトで日本電子の沢田ら が, GaN [211]で63 pm の分解能を達成したが<sup>(21)</sup>,これは 前述したように日本が独自に開発した収差補正装置を適用し ている.しかし、米国は国家プロジェクト TEAM を推進し、 2008年にはじめて分解能 50 pm を切る分解能を実験像の FFT で確認し<sup>(22)</sup>, Ge [114]の 47 pm の観察で実証した<sup>(23)</sup>. 2009年には日本電子も同じ分解能を達成している<sup>(24)</sup>. それ 以降最近まで,その分解能の更新はなされなかったが, 2014年に東京大学・日本電子の研究グループは STEM では 現在でも世界最高分解能となる 45 pm を Si [114]のダンベ ル構造を観察することによって達成している<sup>(1)(25)</sup>.このよ うに収差補正装置の発展に伴い、今世紀に入って飛躍的に分 解能が向上してきたが、分解能競争はほぼ飽和しつつあると いうのが現状である.一方,このような分解能の向上に伴 い、これまでブラックボックスであった種々の材料現象や界 面<br />
・粒界の原子構造が明らかになりつつあり、材料科学の分 野に大きなブレークスルーを与えて続けている<sup>(26)-(29)</sup>.

## 3. STEM 法(HAADF と ABF)

STEM 法は、1 nm 以下に絞った電子プローブを試料上で 走査し、各プローブ位置における散乱電子を試料下部の環状 暗視野検出器(Annular Dark Field (ADF)detector)で収集 し、プローブの走査と同期させてモニター上に像を形成する 手法であり、1960年代後半にCreweにより実用化され た<sup>(30)(31)</sup>.この際、電子プローブを原子カラム間隔以下にま で絞り込むと原子分解能の像を得ることが可能となる.本手 法の特徴は、デフォーカス及び試料厚みの変化に伴う像コン トラストの反転現象が少なく、原子カラムの位置を像から直 接決定できることにある.この優れた特徴は、特に粒界・界 面や格子欠陥等の局所的に構造が乱れた領域の原子構造を決 めるにあたって、非常に有用となる.また前述したように、 1990年代後半に、STEM 法をレンズ収差補正技術と組み合 わされることにより、分解能が大幅に向上し、現在では 0.05 nm(50 pm)を切るプローブ径を得ている<sup>(1)</sup>.

STEM 像は,結像に用いる散乱電子により異なるコント ラストを呈する. 図3にSTEMの概略を示す.電子銃から でた電子線が,電子レンズ(対物レンズ)によって,試料上に プローブを形成する.この際,収差補正装置を用いると0.1 nm以下の極細プローブを得ることができる.このプローブ を試料上で走査させて像を得るが,試料を透過した電子線は 中間レンズ,投影レンズ系を経た後,電子線検出器によって 検出される.検出器には,散乱された電子が入射するが,高 角度に散乱された電子線を検出する手法を HAADF(High Angle ADF) STEM 法と呼び,原子番号Zのおよそ2乗に



図3 STEM における HAADF と ABF 検出器の関係.

比例した像コントラストを得ることができる<sup>(26)(32)</sup>.この際,検出する散乱角度を選択するために検出器は円環状の構成となっている(図3).検出器を低角度側に設定したときは 弾性散乱電子が,高角度側に設定したときは熱散漫散乱 (Thermal diffuse scattering: TDS)電子がそれぞれの像の強度を支配する<sup>(26)(32)</sup>.

上述したように, HAADF STEM では, 検出器の内角を 大きく(通常プローブ収束角の2倍程度以上)とり, 高角散 乱された電子のみを選択的に検出するよう設定する.しか し、電子散乱能の小さい軽元素原子からの信号は非常に弱 く、特に重い原子と隣接する場合、軽元素原子からの信号は 重元素原子からの信号により検出し難くなるため、HAADF STEM 法は軽元素原子観察には向いていない. これを克服 する観察手法として、2009年に東京大学と日本電子の共同 研究グループは,環状明視野(ABF (Annular Bright Field)) STEM 法を提唱した<sup>(33)-(35)</sup>. 図3には ABF STEM 観察に おける検出器の配置についても示している. ABF 法では, 検出器の外角をプローブ収束角と同程度に設定し、検出器内 角をその半分程度にすることで,明視野領域の透過散乱電子 を選択的に検出するよう設定する手法である.図4に、チタ ン酸ストロンチウム(SrTiO<sub>3</sub>)結晶を[110]方向から観察した (a) HAADF および(b) ABF STEM 像を示す<sup>(33)-(35)</sup>. これよ り, HAADF像では, Ti原子カラムとSr原子カラムは観察 されるが、酸素原子カラムは観察できないことが分かる. -方,ABF像は,明視野像であるため,HAADF像とはコン トラストが逆転しているが(原子カラムが黒く観察される), Sr および Ti の原子カラムに加えて、酸素原子カラムが明瞭 なコントラストとして観察されていることが分かる.図中に は結晶構造モデルおよびシミュレーション像も示している が、酸素原子カラムとSr および Ti 原子カラム位置を各コ ントラストから直接同定できる. ABF STEM 像では,全て の原子カラム位置が暗コントラストとして結像されることに なる. ABF 法の理論計算によると、特殊な条件下において は、その像コントラストが広範な元素に対しておよそ原子番 号の3分の1乗(Z<sup>1/3</sup>)に比例することが報告されてい



図4 チタン酸ストロンチウム結晶の[110]方向からの
 STEM 像. (a) HAADF STEM 像および(b) ABF
 STEM 像. 各挿入図は原子構造モデルとシミュ
 レーション像<sup>(33)</sup>.





図5 チタン酸ストロンチウム結晶の[110]方向からの (a) ABF STEM 像,(b) Sr-L 線マッピング像, (c) Ti-K 線マッピング像,(d) O-K 線マッピング 像(東大 熊本らによる).

Z<sup>(33)-(35)</sup>.

一方,最近では収差補正 STEM 法とエネルギー分散型 X 線分光法(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy: EDS ある いは EDX)や電子エネルギー損失分光法(Electron Energy-Loss Spectroscopy: EELS)を組み合わせることにより、原子 分解能での組成分析や状態分析も可能になってきている. そ の一端は本特集号にも紹介されているので(本特集号武藤俊 介氏の記事参照), ここでは, 原子分解能 STEM 法を EDS 法と組み合わせて、局所領域の組成分布を原子分解能で分析 した結果について示す. STEM-EDS においては, 大検出面 積を有する Si ドリフト検出器(SDD)の普及により原子分解 能での原子配列および組成分布の同時可視化が可能となって きた. 図5は SrTiO3の[110]方向からのABF STEM 像と これに対応する各 Sr-L線, Ti-K線, O-K線を用いてマッ ピングした像である. これより, ABF STEM 像中の暗コン トラストがどの元素に対応するかが明瞭に分かる.ただし晶 帯軸方向から観察すると、電子線のチャネリングにより、測 定される X線の強度は必ずしも定量的ではないことに注意 する必要がある.

### 4. 収差補正電子顕微鏡の普及と材料解析への応用

前述したように、収差補正装置の開発は、1990年代後半 からドイツ、米国で開始されたが、日本は開発当初で大きな 遅れをとった.その結果、TEM もSTEM も日本の電子顕 微鏡メーカの収差補正装置には、ドイツ CEOS 社の Rose 型 6極子球面収差補正装置が導入されている.現在でも200 kV級電子顕微鏡のほぼ全てに CEOS 社の収差補正装置が搭 載され市販されている.しかし、1995年から12年後の2007 年ではあるが、日本電子が、前述した独自の収差補正装置を 開発し、300kVTEM に搭載した<sup>(17)</sup>.同社はさらに2009年、 3段の12極子と転送レンズを高度に組み合わせたデルタ型収 差補正装置を低加速電圧電子顕微鏡に搭載した<sup>(36)</sup>.後述す るが、低加速電圧電子顕微鏡では、電子線照射損傷を軽減す ることにより、カーボンナノチューブなどソフトマターへ適 用でき、30 kV の低加速電圧においても Si[110]で 0.136 nm の分解能を達成している<sup>(37)</sup>.

次に収差補正電子顕微鏡の材料への応用について述べる. 収差補正を用いた最初の報告は,1998年に,収差補正 TEM で初めて CoSi<sub>2</sub>/Si 界面を観察した Haider らの結果であ る<sup>(38)</sup>.一方,収差補正 STEM による最初の観察は,2002 年の Batson and Krivanek が金の微粒子を観察した論文であ ろう<sup>(19)</sup>.また,2004年には Urban らのグループが,負の球 面収差を利用した HRTEM というユニークな観察法によ り,軽元素である酸素原子カラムの観察に成功している<sup>(39)</sup>.

一方我国における収差補正電子顕微鏡の最初の導入は, 2001年から開始した文部科学省の科学技術振興調整費によ る研究課題"アクティブ・ナノ計測基盤技術の確立"にさか のぼる.本研究プロジェクトは、財ファインセラミックスセ ンター(JFCC),名古屋大学,東京大学が連携した国家プロ ジェクトであったが、これを起点として、2002年から2005 年にかけて CEOS 社のイメージング収差補正装置が名古屋 大学の 200 kV 透過電子顕微鏡(日本電子 JEM 2100F)に, プローブ収差補正装置が東京大学の同型の200kV透過電子 顕微鏡(2100F)に導入された<sup>(5)(40)(41)</sup>.それ以降, CEOS社 の収差補正装置を既存の電子顕微鏡に装着するという方式で 普及しはじめたが、2008年に日本電子が収差補正装置一体 型の原子分解能電子顕微鏡(JEM ARM 200F)の市販に至 り,現在までに我国において約60台,海外へは約100台が導 入され普及しているようである. 一方 FEI 社は2005年の段 階で既に TITAN 80-300 Series として収差補正装置一体型 商用機の販売を開始していた.

さて、本節では、現段階の収差補正 STEM でどこまで材 料の解析が可能なのかについて二つの代表的な例を紹介した い.最初は結晶内の原子1個の観察が可能になったこと、 次に ABF による軽元素の直接観察について述べる.まず、 結晶内のドーパントー個の観察について、Ce をドープした 立方晶窒化ホウ素(cBN)の観察結果について示す<sup>(42)</sup>.この 材料は青色発光を示すことが知られている(図**6**(a)).Ce(Z



図6 (a) 青色発光を示す単結晶の立方晶窒化ホウ素, (b) HAADF STEM 像:単原子状態で Ce が分散 している様子が分かる.(c) (b)の拡大像:ダンベ ルの左側がやや明るく,左:窒素,右:ホウ素の 原子位置を示している.丸で囲んだ明るいコント ラストは Ce の原子位置を表しており,窒素サイ トを占有している<sup>(42)</sup>.



図7 (a)LiCoO<sub>2</sub>結晶の ABF-STEM 像(リチウム原子 カラムが観察できる), (b)YH<sub>2</sub>結晶の ABF-STEM 像(水素原子カラムが観察できる).

=58)は重元素であるため,HAADF-STEM 像では明るい 原子像として映し出され、図6(b)に示すようにCeが単原 子状態でランダムに分布していることが明瞭に観察できる. さらに高い倍率で観察すると、図6(c)に示すように、① 0.09 nm の距離に並んだホウ素(Z=5)と窒素(Z=7)のダン ベルが分解していること,②原子番号の近いホウ素と窒素が コントラストから区別可能なこと、③添加された Ce はすべ て窒素サイトを占有していることが確認できる(42). さらに EELS によるドーパント1個からの EELS 分析を行ったと ころ, 窒素サイトのCeは3価であることが分かった.一般 に添加元素が陽イオンである場合、局所的な電気的中性を保 っために陽イオンサイトを置換するが、観察された Ce は陰 イオンである窒素サイトを置換しており、Ce原子が安定に 存在するためには周囲に原子空孔が導入される必要があるこ とが予測される.系統的な第一原理計算によりその固溶状態 を計算した結果, Ce と配位している4つすべてのホウ素が 原子空孔を作ることによって大きな空間を形成し、サイズの 大きな Ce が窒素サイトに安定に固溶していることが明らか となっている<sup>(42)</sup>.

一方、軽元素の直接観察についてであるが、多くの機能材

料は、酸素、炭素、窒素などの軽元素で構成されており、し ばしば軽元素の挙動がその機能特性と密接に関係している. 上述した ABF-STEM 法を用いることで酸素が観察される ことは上述したが、ここではさらに軽い元素が観察できるか どうかについて述べる.まず原子番号3番のリチウム原子 の観察に着目する.その観察対象としてリチウムイオン電池 材料を用いた. 図7(a)は,層状構造を有するLiCoO2結晶中 を[1120]方向から観察した ABF-STEM 像である. 強い黒 コントラストを有するコバルト(Co:原子番号27番)原子列 に加えて、リチウム(Li:原子番号3番)原子列が酸素(O: 原子番号8番)原子層の間に明瞭に観察されていることが分 かる<sup>(43)</sup>. この図は, 8-25 mrad の検出角度で観察した像で あるが,軽元素も重元素も同時に観察できている.図7(b) は水素化イットリウム(YH2)結晶を[001]方向から観察した ABF 像である. YH<sub>2</sub> は Y 原子による副格子が面心立方構造 を有しており、その四面体空隙をHが占有する構造となっ ているが,図に示すように,Y原子間に存在するH原子カ ラムの存在位置に弱い暗コントラストが観察されていること が分かる. このようなコントラストが H 原子カラムの存在 に起因する信号に由来することは, Bloch wave 法によって 計算したシミュレーション像によって既に確認されてい る<sup>(44)</sup>. すなわち,図7(b)のABF-STEM像は,水素原子カ ラムが直接観察できていることを実証した像である. このよ うに、ABF-STEM 法は軽元素の直接観察に優れ、現段階で は最小の原子である水素原子カラムの観察までもが可能な域 に達している<sup>(44)(45)</sup>.

#### 5. 今後の新展開—低加速·高分解能化·新検出器

カーボンナノチューブやグラフェンなどカーボン系材料や ソフトマターは電子線照射に弱く、低加速で観察することが 望ましいが、電子顕微鏡の低加速・高分解能による研究も大 きく進展しつつある<sup>(36)(46)</sup>.電子顕微鏡の低加速化は試料の ノックオンダメージ(はじき出し)を抑えるのにも非常に効果 的であり、たとえばフラーレン分子やグラフェンのエッジ原 子の場合は、ダメージを抑えるために加速電圧 35 kV 以下 で観察することが望ましいとされている<sup>(46)</sup>.低加速電圧に おいても原子分解能を実現するためには収差補正技術の高性 能化が必要となる.これを克服するために、末永らは上述し たデルタ型収差補正装置を低加速電圧電子顕微鏡に搭載し た<sup>(46)</sup>. その結果,加速電圧 60 kV において 82 pm, 30 kV において111 pm と波長比においては世界最高の空間分解能 を得ているが(46)(47),最近ではさらに分解能が向上し,波長 比の分解能で15倍程度が達成されている(48).低加速電圧の 場合でも電子線を細く絞ることができ、分子構造などを破壊 することなく十分な散乱信号の取得が可能であるため、効率 的にナノカーボン材料などの原子レベル観察および分析が実 現されている. また, 紙面の関係で, 色収差補正については 述べなかったが、情報限界と関係する色収差補正技術も大き く進展しつつあり、さらなる原子分解能の向上が期待されて

いる(49).

一方,局所領域の電場や磁場を観察する手法としての微分 位相コントラスト(DPC)法においても大きな進展があっ た.最近,柴田らは原子分解能観察対応の多分割STEM 検 出器を開発し<sup>(50)-(52)</sup>,検出器上での位置・角度に依存した 複数の原子分解能STEM 像を1回のスキャンにより同時計 測することに成功している.このような検出器を用いれば, 入射電子のわずかな軌道変化を捉えることができ,原子レベ ルの電磁場を直接計測することも可能となり,原子構造のみ ならず電磁場の局所構造が解明できる.この原子分解能 DPC STEM 法は今後益々進展していくことが期待できる. 究極的には,化学結合状態や電子雲の直視も可能となること が期待され,筆者は,5年後には現在の多くの原子レベルの 解析が本手法にとって代わるものと予測している.

#### 6. ま と め

本稿では今世紀に入って大きな進展があった収差補正 TEM および STEM によるイメージングを中心に,その歴 史的経緯,分解能の向上,新しい観察法の登場,収差補正器 の急速な普及と材料科学への応用について,概観した.

歴史的な記述もあるので,本分野に精通した複数の研究者 に年代の記述など,注意深く確認を頂いた.日本電子株式会 社の沢田英敬博士,東京大学の阿部英司博士,柴田直哉博 士,石川 亮博士に謝意を表す.

#### 文 献

- H. Sawada, N. Shimura, F. Hosokawa, N. Shibata and Y. Ikuhara: Microscopy, 64 (2015), 213.
- (2) T. Akashi, et al.: Applied Physics Letters, 106 (2015), 074101.
- (3) D. A. Muller: Nature Materials, 8(2009), 263-270.
- (4) H. Rose: J. Elect. Microsc., 58(2009), 77-85.
- (5) 原田嘉晏, 富田正弘:電子顕微鏡, 46, 別冊, No.3 (2011), 1-47.
- (6)黒田光太郎:材料の科学と工学、日本材料学会、48(2011)、 221-226.
- (7) O. Scherzer: Optik, 2(1947), 114–132.
- (8) G. D. Archard Br.: J. Phys., 5(1954), 294–299.
- (9) P. W. Hawkes: Phil. Trans. R. Soc. Lond. A, 257 (1965), 479– 552.
- (10) V. Beck: Optik., 53(1979), 241–255.
- (11) A. V. Crewe and D. Kopf: Optik, 55(1980), 1–10.
- (12) H. Rose: Optic, 85 (1990), 19–24.
  (13) M. Haider, G. Braunshausen and E. Schwan: Optic, 99 (1995), 167–179.
- (14) O. L. Krivanek, N. Delby and A. R. Lupini: Ultramicroscopy, 78(1999), 1–11.
- (15) 沢田英敬, 三宮 工, 細川史生: セラミックス, 40(2005), 908.
- (16) 阿部英司:科学技術動向, 11,科学技術·学術政策研究所出版(2010),9-22.
- (17) H. Sawada, et al.: Ultramicroscopy, 108(2008), 1467–1475.
- (18) F. Hosokawa, H. Sawada, Y. Kondo, K. Takayanagi and K. Suenaga: Microscopy, 62(2013), 23-41.
- (19) P. E. Batson, N. Dellby and O. L. Krivanek: Nature, 418 (2002), 617–620.
- (20) P. D. Nellist, et al.: Science, 305(2004), 1741.

- (21) H. Sawada, et al.: Jpn. J. Appl. Phys., 46(2007), L568.
- (22) C. Kisielowski, *et al.*: Microsc. Microanal, 14(2008), 469–477.
  (23) R. Erni, M. D. Rossell, C. Kisielowski and U. Dahmen: Phy.
- Rev. Lett., **102**(2009), 096101.
- (24) H. Sawada, et al.: J. Elect. Microsc., 58 (2009), 357–361.
- (25) 日本経済新聞, 2014/9/3付け, 夕刊1面, 電子版 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGG31H07\_ T00C14A9MM0000/.
- (26) S. J. Pennycook and P. D. Nellist (Ed): Scanning Transmission Electron Microscopy: Imaging and Analysis, Springer, (2011).
- (27) N. Tanaka (Ed): Scanning Transmission Electron Microscopy of NanoMaterials–Basics of Imaging and Analysis–, Imperial College Press, (2014).
- (28) 幾原雄一:応用物理, 81(2012), 753-759.
- (29) Y. Ikuhara: J. Elect. Micros., **60** (Supplement 1) (2011), S173– S188, doi:10.1093/jmicro/dfr049.
- (30) A. V. Crewe, J. Wall and J. Langmore: Science, 168(1970), 1338.
- (31) 山口まり:日本物理学会誌, 70(2015), 51-53.
- (32) S. J. Pennycook and D. E. Jesson: Ultramicroscopy, **37**(1991), 14–38.
- (33) S. D. Findlay, N. Shibata, H. Sawada, E. Okunishi, Y. Kondo, T. Yamamoto and Y. Ikuhara: Appl. Phys. Lett., 95(2009), 191913.
- (34) S. D. Findlay, N. Shibata, H. Sawada, E. Okunishi, Y. Kondo and Y. Ikuhara: Ultramicrosocpy, 110(2010), 903–923.
- (35) 柴田直哉, フィンドレイ スコット, 幾原雄一:顕微鏡, 46 (2011), 55.
- (36) H. Sawada, et al.: J. Electron. Microsc., 58(2009), 341-347.
- (37) T. Sasaki, et al.: J. Electron. Microsc., 59(2010), S7–S13.
- (38) M. Haider, S. Uhlemann, E. Schwan, H. Rose, B. Kabius and K. Urban: Nature, **392**(1998), 768.
- (39) C. L. Jia and K. Urban: Science, 303(2004), 2001.
- (40) 平山 司,幾原雄一,田中信夫:まてりあ,41(2002),598-603.
- (41) 田中信夫: 顕微鏡, 46(2010), 175-180.
- (42) R. Ishikawa, N. Shibata, F. Oba, T. Taniguchi, S. D. Findlay, I.

Tanaka and Y. Ikuhara: Phys. Rev. Lett., **110**(2013), 065504.

- (43) R. Huang, T. Hitosugi, S. D. Findlay, C. A. J. Fisher, Y. H. Ikuhara, H. Moriwake, H. Oki and Y. Ikuhara: Appl. Phys. Lett., 98 (2011), 051913.
- (44) S. D. Findlay, T. Saito, N. Shibata, Y. Sato, J. Matsuda, K. Asano, E. Akiba, T. Hirayama and Y. Ikuhara: Appl. Phys. Express, 3(2010), 116603.
- (45) R. Ishikawa, E. Okunishi, H. Sawada, Y. Kondo, F. Hosokawa and E. Abe: Nat. Mater., 10(2011), 278.
- (46) 末永和知ら:顕微鏡, 45(2010), 31.
- (47) K. Suenaga and M. Koshino: Nature, 468(2010), 1088.
- (48) H. Sawada, T. Sasaki, F. Hosokawa and K. Suenaga: Phys. Rev. Lett., **114**(2015), 166102.
- (49) F. Hosokawa, H. Sawada, Y. Kondo, K. Takayanagi and K. Suenaga: Microscopy, 62(2013), 23–41.
- (50) N. Shibata, Y. Kohno, S. D. Findlay, H. Sawada, Y. Kondo and Y. Ikuhara: J. Electron. Microsc., 59 (2010), 473–479.
- (51) N. Shibata, S. D. Findlay, Y. Kohno, H. Sawada, Y. Kondo and Y. Ikuhara: Nature Physics, 8(2012), 611.
- (52) 柴田直哉, S. D. Findlay, 幾原雄一:固体物理, 48(2013), 55-63.

博士課程修了(工博) 同年7月 財団法人ファインセラミックスセンタ ー研究員 1993年7月 同センター統括部長代理,主幹研究員 1996年7月 東京大学大学院工学系研究科・材料学専 攻・助教授

2003年1月 同研究科・総合研究機構・教授・ナノ 工学研究センター長

幾原雄一

エチャリカモンク K 財団法人ファインセラミックスセンター・主管研究員 (兼任),東北大学原子分子材料科学高等研究機構・教 授(兼任)

専門分野:結晶界面工学,先端透過電子顕微鏡法 ◎先端透過電子顕微鏡法の材料科学への応用と結晶界

面に関する研究に従事.

\*\*\*\*\*\*\*